

2026年5月26日

開催案内 ワークショップ NGL2026

応用物理学会次世代リソグラフィ（NGL）技術研究会では、今年も NGL ワークショップ（ワークショップ NGL2026）を開催する予定です。本年も多くの方々に参加していただきたく、下記に概要をお知らせいたします。3 件の基調講演をはじめ、充実したプログラムを準備いたしました。皆様のご参加をお待ちしております。

応用物理学会 次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 原田 哲男

記

会期：2026年7月2日（木）、3日（金）

会場：東京科学大学 70 年記念講堂（受付・口頭講演）・蔵前会館（ポスター）*
（東急目黒線、大井町線大岡山駅前）

*詳細については以下のホームページ（下記 URL）をご覧ください。

<https://www.ssc.titech.ac.jp/amap/home/ookayama/west/70th-anniversary-auditorium/>
蔵前会館 <http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html>

プログラム概要：

基調講演：

“北海道・千歳に集積する Rapidus と LSTC が描く先端パッケージと光電融合の未来”
折井 靖光氏（Rapidus）

“Transforming Advanced Semiconductor Manufacturing with an EUV FEL”
Nicholas Kelez 氏（xLight）

“EUV リソグラフィのロードマップ：Low-NA から High-NA、そして Hyper-NA への展開”
永原 誠司氏（ASML ジャパン）

技術セッション：

7/2 光リソグラフィ&アドバンスパターンニング、レジスト材料、ポスターセッション

7/3 ナノインプリント、EB・計測・マスク技術、EUVL

*ポスターセッション後に軽食を提供いたします。

主催： 応用物理学会 次世代リソグラフィ技術研究会（分科会）

協賛： 応用物理学会 シリコンテクノロジー分科会

NGL2026 企画運営委員会：

委員長：原田 哲男 副委員長：岡崎 信次

委員：宮本 恭幸、猩々 智康、古澤 孝弘、井谷 俊郎、中川 勝、石原 直、松井 真二、堀内 敏行、
田川 精一、三田 吉郎、雨宮 智宏、落合 幸徳、老泉 博昭、笑喜 勉、酒井 啓太、
幡野 正之、尹 成圓、鈴木 章義、渡邊 陽司、引地 龍吾、伊藤 高臣、岩城 友博、
古巻 貴光、本多 孝好、谷川 貴紀、近藤 博基、鈴木 一明

事務局：相良好美

E-mail：ngl@jsap.or.jp, TEL: 090-5403-1147

参加費※：税込み（消費税課税）表示

主催・協賛団体会員、学生：	3,000円（6月15日以前の申し込み）
	4,000円（6月16日以降の申し込み）
一般：	18,000円（6月15日以前の申し込み）
	20,000円（6月16日以降の申し込み）

※申し込み後、指定の期日までにクレジットカード、コンビニ決済等でお支払いください。

申し込み方法： 下記の申し込み専用ホームページからお申し込みください。

https://eventpay.jp/event_info?shop_code=2826022165321700&EventCode=C561242090

応用物理学会次世代リソグラフィ技術研究会は、本ワークショップの他、年に3回程度、会員が無料で参加できる定例研究会を開催しております。当研究会には、法人（賛助）会員、個人会員としての入会が可能です。ご興味のある方は上記事務局までご連絡ください。

以上